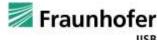
DGKK-Arbeitskreis "Herstellung und Charakterisierung von massiven Halbleiterkristallen" am 8./9. Okt. 2014 in Freiberg

Defektlumineszenz in 4H-SiC

Daniel Kaminzky,

- B. Kallinger, P. Berwian,
- J. Friedrich (Fraunhofer IISB)
- S. Oppel, M. Schütz (Intego Vision Systeme)





Inhalt

- Motivation
- Photolumineszenz
- Vorstellung PL-Defektlumineszenzscanner
- Photolumineszenzmessungen an 4H-SiC Epitaxieschichten
- Zusammenfassung
- Ausblick

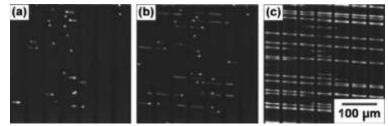


Motivation

SiC in der Leistungselektronik

Leistungsfähigkeit von SiC-Bauelementen kann durch strukturelle und kristallographische Defekte in Epitaxieschichten begrenzt sein

- Stapelfehler
- Basalflächenversetzungen
- (threading dislocations)



Bipolardegradation in 4H-SiC p-i-n Diode [1]

Etablierte Charakterisierungsmethoden:

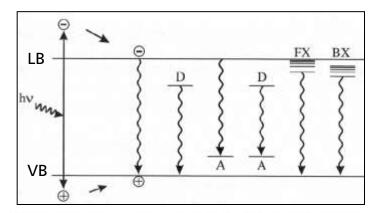
- Defektselektives Ätzen (nicht zerstörungsfrei)
- Synchrotron Röntgentopographie (zeitaufwändig, kostenintensiv)
- UV-PL (zerstörungsfrei, schnell, hochauflösend, abbildendes Verfahren, keine Probenpräparation, Mapping des gesamten Wafers)

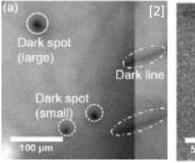


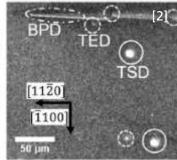
Photolumineszenz: Phys. Grundlagen

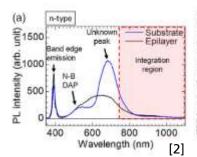
Photolumineszenz:

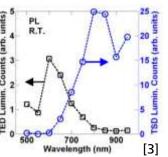
- > Anregung durch Absorption von Photonen ($hv > E_q$)
- Erzeugung von Elektronen-Loch-Paaren
- Rekombination: Direkt oder über Zwischenniveaus in der Bandlücke
- Nicht strahlende bzw. strahlende Rekombination (Lumineszenz)
- Defekte als strahlende bzw. nichtstrahlende Rekombinationszentren
- Defektspezifische PL-Wellenlänge (Spektraler Fingerabdruck)













Photolumineszenz

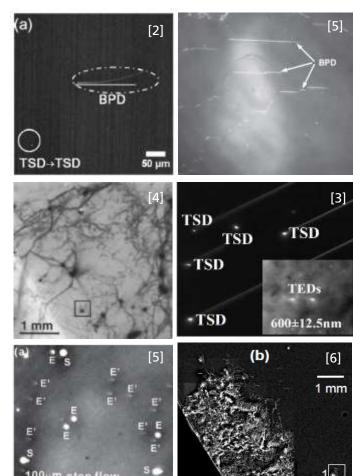
Untersuchung der Photolumineszenz an Defekten in SiC

Mehrere Arbeitsgruppen:

- Messaufbauten für Forschungszwecke
- Lokale Untersuchung
- Mapping des ges. Wafers mehrere Stunden
- Grundlagenforschung

Fraunhofer IISB und Intego:

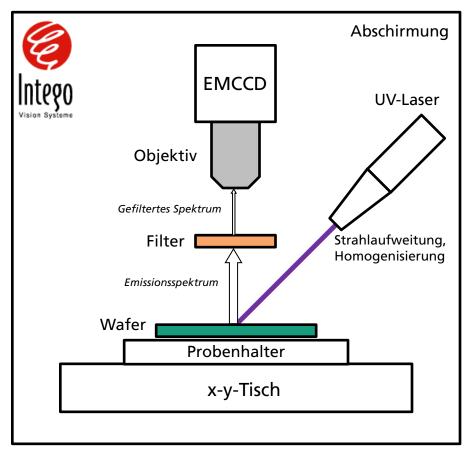
- Entwicklung eines kommerziellen, anwendungsorientierten Tool zur Defektcharakterisierung an SiC
 - UV-PL-Defektlumineszenzscanner





Messprinzip: Defektlumineszenzscanner

Schematischer Aufbau und Kenndaten



Klasse 1 Lasersystem

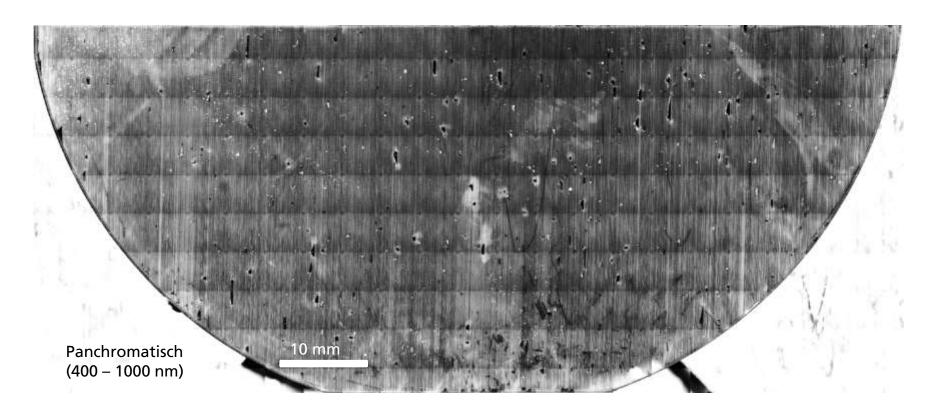
- UV-Laser: 325 nm (cw)
- Eindringtiefe: ca. 8 µm
- EMCCD-Kamera (400 1000 nm)
- Objektiv: x2,5 (x5,0)
- Bandpassfilter:
- $\lambda = 450 \pm 40 \text{ nm}$
- $\lambda = 540 + 40 \text{ nm}$
- Langpassfilter: $\lambda > 590 \text{ nm}$
- x-y-Tisch (bis zu 6")
- Laterale Aufl.: 5 µm
- Messdauer: 10 30 min

Messprinzip: Defektlumineszenzscanner

Geräteaufbau im FhG-Reinraum



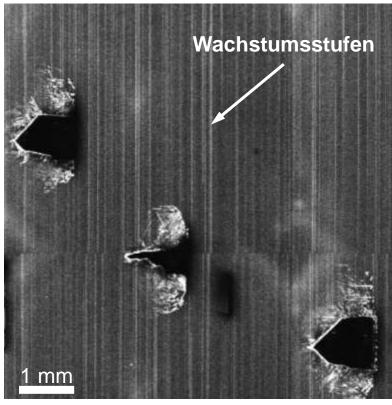
Typisches PL-Mapping an epitaktischem n-4H-SiC (defektbehaftet)



Diverse strukturelle Auffälligkeiten → Klassifizierung



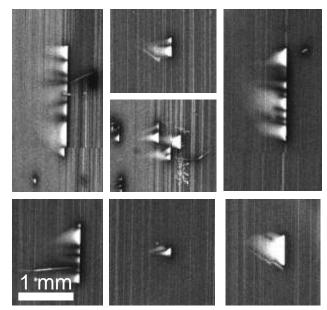
Dunkle Dreiecksdefekte (Stapelfehler) mit Basalflächenversetzungen



Panchromatisch

- Stapelfehler als Dreiecke
- Dunkles Zentrum
- Helle Kanten und Nukleationsort
- Gestörter Bereich um Dreiecksdefekte
- Helle feine Linien zeigen Basalflächenversetzungen
- Helle parallele Linien (senkrecht zur Stufenflussrichtung): Wachstumsstufen

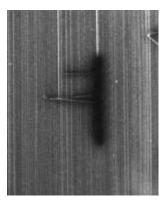
Helle Dreiecksdefekte (Stapelfehler)

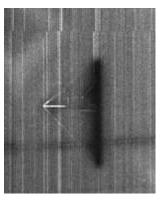


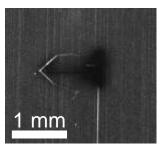
Panchromatisch

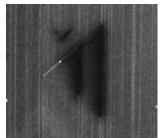
- Dunkler stabförmiger Bereich mit hellen dreiecksförmigen Bereichen
- Mehrere helle Bereiche entlang eines Defektes
- Überlagerung von mehreren Stapelfehlern möglich

Stabförmige Defekte (Stapelfehler)





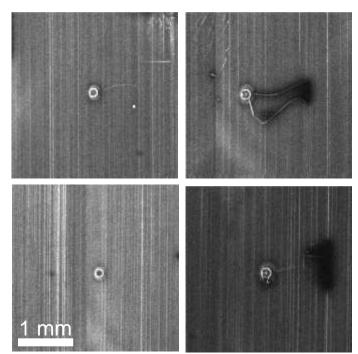




Panchromatisch

- Stapelfehler als dunkler stabförmiger Bereich
- Heller dreiecksförmiger Bereich am Nukleationsort
- Anderes Erscheinungsbild als "Dreiecksdefekte"

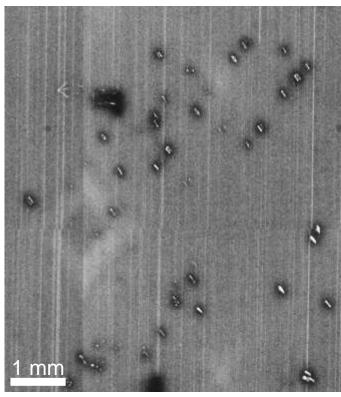
Ringförmige Defekte



- > Heller ringförmiger Bereich
- Eingewachsene Partikel oder Mikroröhren
- Nukleationsort für Dreiecksdefekte (Stapelfehler)

Panchromatisch

"Reisförmige" Defekte

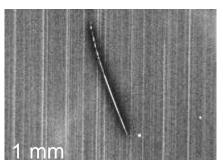


Panchromatisch

- Helles "reisförmiges" Zentrum mit dunkler Umrandung
- Vorzugsorientierung
- Ähnliche Defekte aus Literatur bekannt (threading dislocations?)

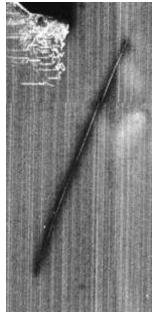
Linienhafte Defekte





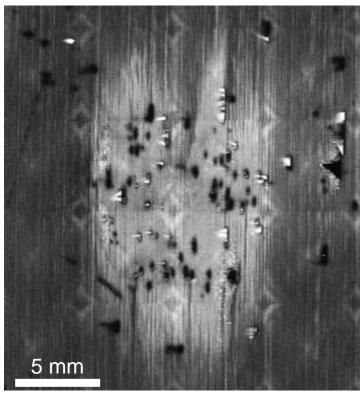






- Helle Linienhafte Defekte mit dunkler Umrandung
- Keine Vorzugsorientierung, willkürliche Anordnung
- Vermutlich Kratzer?

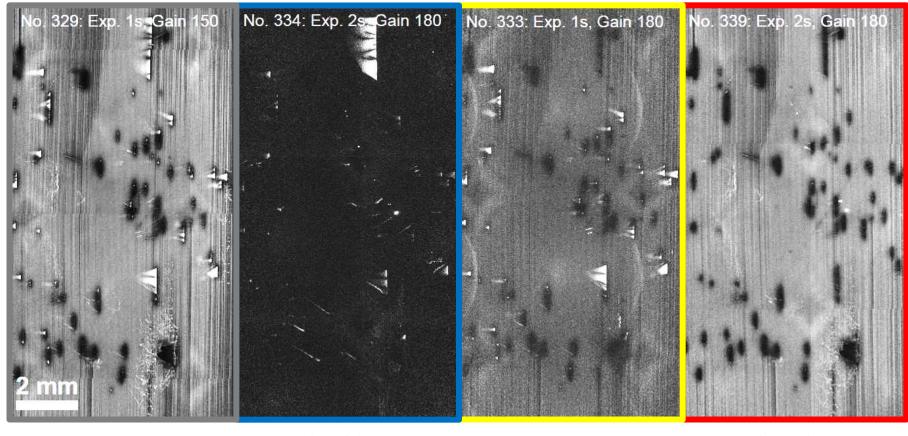
Facette



Panchromatisch

- Hellerer Bereich an Facette im Vergleich zur Umgebung
- Dotierungsinhomogenität?

Wellenlängenspezifische Photolumineszenz



400-1000 nm

410-490 nm

510-590 nm

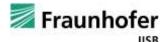
540-740 nm



Zusammenfassung

Untersuchung der Defektlumineszenz in 4H-SiC Epitaxieschichten

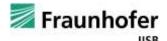
- Implementierung eines Defektlumineszenzscanners für SiC (Prototyp)
 - Anwendungsorientiert, vollflächig, "state-of-the-art" inline Charakterisierungstool
- Klassifizierung unterschiedlicher struktureller Epidefekte
 - Diverse Stapelfehler (Dunkle bzw. helle Dreiecke und Balken)
 - Mikroröhren, eingewachsene Partikel
 - Basalflächenversetzungen
 - > Threading dislocations (einzeln bzw. Netzwerke)
 - Dotierungsinhomoginitäten
 - Kratzer
 - Ungeklärte Auffälligkeiten
- Untersuchungen zur spektralen Defektcharakteristik
 - Spektraler Fingerabdruck spezieller Defekttypen (optische Filter)



Ausblick

Technische Verbesserungen und weitere Untersuchungen

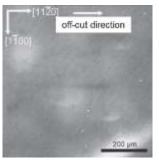
- Upgrade Defektlumineszenzscanner:
 - Beleuchtungsquellen für untersch. Anregungswellenlängen
 - Eindringtiefe (Untersuchung Defektursprung und Tiefe)
 - Automatisierte Defektauswertung und -klassifizierung
 - Homogenisierungsoptik (Rauschunterdrückung)
 - Dunkel- und Hellfeldbeleuchtung (Lichtmikroskop)
 - Hochauflösendes Mikroskop (5x, 10x, ...)
 - Zusätzl. Filter: >750 nm, 900 ± 5 nm
- Korrelationen zwischen PL-Mappings und...
 - Lichtmikroskop-Mappings (Dreiecksdefekte, Partikel, Makrodefekte)
 - Lebensdauer Messungen (Auswirkung auf effektive Lebensdauer)
 - KOH-geätzten Proben (TDs, BPDs)
 - Zeitaufgelöste-PL (spektral aufgelöste Messungen)



Ausblick

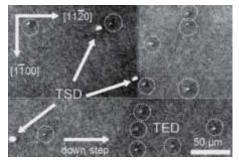
Einfluss von Punktdefekthaushalt auf PL von Versetzungen

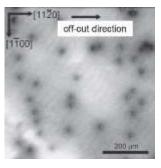




Wie gewachsen

Keine Auffälligkeiten in UV-PL





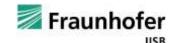
Thermisch behandelt

Abbildung von Stufen- und Schraubenversetzungen

Punktdefekthaushalt beeinflusst Photolumineszenz von Versetzungen



Studien zur thermischen Oxidation und Ausheilung am IISB



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Diese Arbeit ist Teil des SiCWinS-Projekts und wird durch die Bayrische Forschungsstiftung (BFS) finanziert (AZ-1028-12).



